

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-062877

(43)Date of publication of application : 12.03.1993

(51)Int.Cl.

H01L 21 027
G02B 17 06
G03F 7 20
G03F 7 20

(21)Application number : 03-327947

(71)Applicant : SHINOHARA YASUKO

(22)Date of filing : 02.09.1991

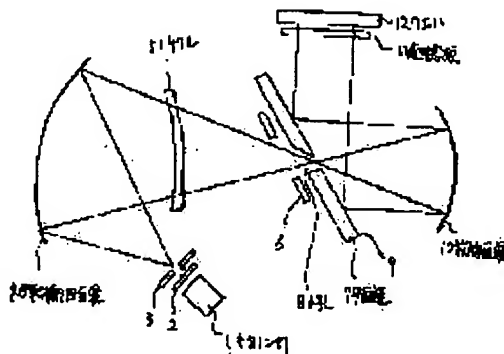
(72)Inventor : SHINOHARA YASUKO

(54) OPTICAL SYSTEM FOR LSI MANUFACTURING CONTRACTION PROJECTION ALIGNER BY LIGHT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a mirror type stepper in which a short wavelength ultraviolet ray is used as a light source and which has a deep focal depth, a wide exposure area and a large numerical aperture.

CONSTITUTION: A light source is mounted at one focal point of a rotational elliptical concave mirror, the small hole 8 of the mirror 7 is mounted at the other focal point, and the hole 8 also becomes a focal point of a parabolic mirror 10. A high coherent light is used as a light source thereby to deepen a focal depth, to remove various aberrations and to improve an effective numerical aperture. Further, a reticle image is increased larger than an image on a wafer and the width of the wavelength of an illumination light is increased thereby to prevent deterioration of the image due to the use of the coherent light. In this case, its resolution is improved when transparent liquid is filled between optical systems.



*** NOTICES**

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1 An optical system of an LSI manufacture reduced-projection-exposure device were in agreement in a stoma which has an exposure mechanism concentrated on one point ahead of reticle, and a plane mirror has in one point which the light concentrates, having installed a plane mirror, and installing a concave mirror in a confrontation of a mirror plane of the plane mirror.

[Claim 2 The LSI manufacture reduced-projection-exposure device of structure which fills space between optical systems with a transparent fluid, and is carrying out circulation ** of the transparent fluid according to claim 1.

[Translation done.]

* NOTICES

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention

[0001][Industrial Application This invention relates to the optical system of the LSI manufacture reduced-projection-exposure device (stepper) by a mirror type light.

[0002][Description of the Prior Art There is a stepper of a mirror type actual size package projection aligner and lens types conventionally.

[0003][Problem(s) to be Solved by the Invention In the optical system of an actual size package projection aligner conventional mirror type, since only the linear image of the rate of actual size was acquired, precise position doubling of the mask image was difficult, the influence by dust was great, and there were problems, like it is difficult to correct a total defect and there is.

[0004]At the stepper of the conventional lens types, the problem of the little of an usable transparent substance, the lowness of transparency, and the endurance of a lens was on the lens by ultraviolet C.

[0005]This invention has an optical system of the mirror type which can use ultraviolet C, and an object of this invention is to provide the stepper which has the deep depth of focus with high resolution and a large exposure area.

[0006][The means for solving a technical problem To achieve the above objects, in the optical system of this invention stepper, high coherent light of a comparatively large wavelength band is used as a light source, and it puts with a condensing concave mirror among in one ahead of reticle. [0007]It is in agreement with one of the light in the stoma which a plane mirror has, and a plane mirror is installed, [0008]A concave mirror is installed in the confrontation of the mirror plane of the plane mirror, and it is made in agreement [the focus of the concave mirror and the stoma of a plane mirror].

[0009]The light from a light source irradiates with reticle, and the stoma of a plane mirror is passed, it becomes a parallel ray mostly with a concave mirror, and a very thin transparent

aperture plate vertical to the parallel ray which reflects and advances with the same plane mirror is installed, [0010]The transparent aperture plate is approached extremely, a wafer is installed, and reduction image formation of the reticle image is carried out on the wafer.

[0011]And reticle is produced on the curved surface which amends image surface curvature.

[0012]filling the space between optical systems with a transparent fluid -- the transparent fluid - circulation **** -- it is effective by the reason things carry out a postscript.

[0013][Function]the light which penetrated reticle -- high -- it is coherent, and if the caliber D and focal distance of the wavelength λ and a condensing concave mirror are set to f , it will concentrate on the stoma of the plane mirror which has 84.6% of total light volume ahead of reticle in the radius of $\gamma = 1.22\lambda f/D$. The circumference presents the diffraction pattern of reticle.

[0014]Since reticle and a transparent aperture plate are made of synthetic quartz in this invention, the surface can be ground smoothly and the influence of the surface by high coherent light use is small.

[0015]In this invention, since it is isolated with the external world that it is also at a transparent window, the convection of air has prevented invasion of dust few again. If whole this invention is brought close to a vacuum, the convection of air and the influence of dust will become small.

[0016]filling the space between mirror optics systems with a transparent fluid on the contrary -- the transparent fluid -- circulation **** -- by things, the influence of the surface of reticle and a transparent aperture plate becomes small, and the influence of dust becomes small. And change is prevented for the rate of optical refraction by a rise in heat for light to be absorbed by the transparent fluid.

[0017]Since it is installed at [a transparent window is very thin and right angles to the light reflected with the concave mirror and the plane mirror, a chromatic aberration is not produced.

[0018]In this invention, since the electrostatic precipitator is installed in the circumference of the stoma of a monotonous mirror between a monotonous mirror and reticle, the dust in a stepper was removed and invasion of the dust to a mirror optics system which leads the stoma of a monotonous mirror has been prevented.

[0019]In this invention, since it is so good that the image pattern on reticle has many transparent portions, it is necessary to take into consideration in image formation. It may be better to enforce reversal of the image of a photoresist depending on an image pattern.

[0020]Although the lacking part corresponding to in LSI manufactured by this invention stepper] the stoma of a monotonous mirror to the central part exists, since a stoma is about 1 mm in diameter, there is no influence on an LSI degree of location. If light volume of a light source can be enlarged, of course, the diameter of a stoma can be set up smaller.

[0021][Example If an example is described with reference to drawings, in drawing 1, it will

install in the optical passage of the light from the xenon light 1 in the xenon light 1, the filter 2, the slit 3, the spheroid concave mirror 4, the reticle 5, the stoma 8 of the plane mirror 7, the parabolic mirror 10, the plane mirror 7, the transparent aperture plate 11, the wafer 12, and this order, The stoma 8 of the plane mirror 7 is installed in one focus of a spheroid concave mirror at the slit 3 and another focus. The stoma 8 also serves as a focus of the parabolic mirror 10 simultaneously. At this time, the mirror plane 9 of the plane mirror 7 faces the parabolic mirror 10, and is installed, and the electrostatic precipitator 6 is attached to the circumference of the stoma 8.

[0022]Several kinds of gas, such as AgammaF and KgammaF, is mixed instead of the xenon light 1, and there is an example which used the agitation excimer laser as the light source about an oscillation wavelength.

[0023]There is an example which uses the lens for aberration compensation instead of the transparent aperture plate 11.

[0024]There is an example which uses other concave mirrors, such as a spherical mirror and a hyperboloid mirror, instead of the parabolic mirror 10.

[0025]In the example shown in drawing 2, the space between optical systems is filled with a transparent fluid, and circulation ** of the transparent fluid is carried out. The reticle 5 is dipped in the tub 13 which fills a transparent fluid.

[0026][Effect of the Device It comprises this invention, as explained above.

Therefore, an effect which is indicated below is done so.

[0027]Since high coherent light is used for the source of reticle irradiation light and it is very among Tsudoi in one ahead of reticle with a spheroid concave mirror, If the caliber D and focal distance of the wavelength λ and a spheroid concave mirror are set to f, it will concentrate on the stoma of the plane mirror which has 84.6% of total light volume ahead of reticle in the radius of $\gamma = 1.22 f/D$. Although the circumference of a stoma serves as a diffraction pattern of reticle, since the central part of a stoma serves as very high light volume as compared with the FUCHI part of the shape of a peripheral ring of the width of the wavelength of the light of a stoma, the rate which light passes the FUCHI part of a stoma and diffraction produces is very small. Therefore, the fall of the resolution by light passing a stoma is very small. This effect becomes large as a stoma approaches the radius of $\gamma = 1.22 \lambda f/D$.

[0028]As for the great portion of light which reaches each point of the image on the surface of a wafer, since it is reflected in the very small range to which a parabolic mirror corresponds, the depth of focus has also become deep and aberration other than image surface curvature or image surface distortion has become very small.

[0029]moreover -- since the great portion of light which reaches each point of the image on the

surface of a wafer is reflected in the very small range to which a parabolic mirror corresponds -
- a parabolic mirror -- calculatively -- ** -- an effective numerical aperture becomes large from a
numerical aperture.

[0030]If high coherent light is used for the source of irradiation light, speckle noise etc. will
appear in the diffraction development of a reticle image, but. Since it is a type reduced to about
[of a reticle image] $1/10$, even if it uses high coherent light for a light source, there is no
degradation of an image that a large reticle image pattern can be taken and by taking a wide
wavelength-range width, since there is no chromatic aberration.

[0031]As for about exposure area $\phi 30\text{mm}$, about 0.35 calculative numerical aperture, and
(effective numerical aperture, more large) is obtained by this invention stepper.

[0032]The mirror type optical system is used in this invention.

Therefore, ultraviolet C can be used from the optical system use stepper of lens types.

[0033]When the refractive index of λ and a transparent fluid is set to η for the
wavelength of light by filling the space between optical systems with a transparent fluid, there
is the same effect using the light of λ/η .

[Translation done.]

* NOTICES

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is a configuration block figure of one example of this invention stepper.

[Drawing 2] It is the lineblock diagram of the reticle periphery of an example which filled between the optical systems of this invention stepper with the transparent fluid.

[Explanations of letters or numerals]

- 1 Xenon light
- 2 Filter
- 3 Slit
- 4 Spheroid concave mirror
- 5 Reticle
- 6 Electrostatic precipitator
- 7 Plane mirror
- 8 Stoma
- 9 The mirror plane of a plane mirror
- 10 Parabolic mirror
- 11 Transparent aperture plate
- 12 Wafer
- 13 The tub which fills a transparent fluid
- 14 Transparent liquid flow which fulfills an optical system

[Translation done.]

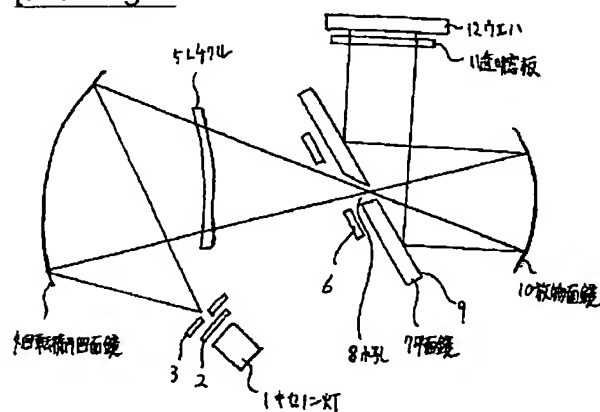
* NOTICES

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

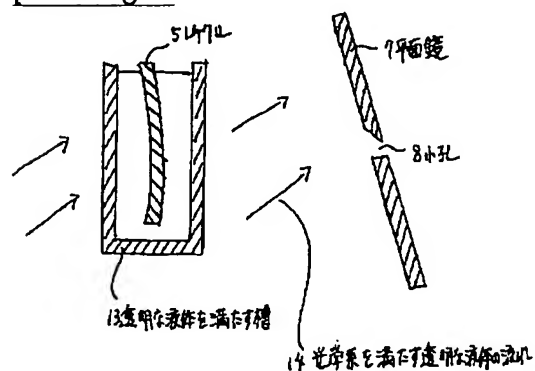
- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

[Drawing 1]



[Drawing 2]



[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-62877

(43) 公開日 平成5年(1993)3月12日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/027				
G 0 2 B 17/06		8106-2K		
G 0 3 F 7/20	5 0 2	7818-2H		
	5 2 1	7818-2H		
		7352-4M		
			H 0 1 L 21/30	3 1 1 L
			審査請求	未請求 請求項の数2(全 3 頁)

(21) 出願番号 特願平3-327947

(22) 出願日 平成3年(1991)9月2日

(71) 出願人 000181538

篠原 康子

兵庫県加古川市加古川町木村669-20

(72) 発明者 篠原 康子

兵庫県加古川市加古川町木村669-20

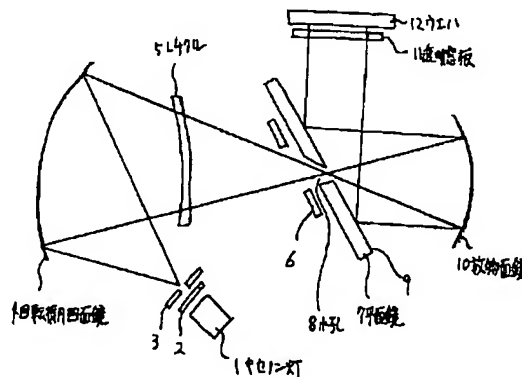
(54) 【発明の名称】 光によるLSI製造縮小投影露光装置の光学系

(57) 【要約】

〔目的〕 短波長紫外線を光源とした、焦点深度が深く露光面積が広くかつ開口数の大きい、ミラータイプのステツパを得る。

〔構成〕 回転楕円凹面鏡の一方と焦点に光源を、もう一方の焦点に平面鏡7の小孔8を設置し、かつその小孔8は放物面鏡10の焦点にもなっている。

〔効果〕 高コヒーレント光を光源とすることにより、焦点深度を深くし種々の収差を除き実効開口数を向上した。又レチクル像をウエハ上の像より大きくとることと、照射光の波長域幅を広くとることにより高コヒーレント光使用による像の劣化を防いでいる。この時光学系間を透明な液体で満たすと解像力が向上する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レチクルの前方の一点に集中する照射機構を有し、その光の集中する一点に平面鏡の有する小孔を一致して平面鏡を設置し、その平面鏡の鏡面の対面に凹面鏡を設置したことを特徴とするLSI製造縮小投影露光装置の光学系。

【請求項2】 光学系の間の空間を透明な液体で満たし、その透明な液体を循環させている構造の請求項1記載のLSI製造縮小投影露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】〔産業上の利用分野〕本発明は、ミラータイプの光によるLSI製造縮小投影露光装置（ステツバ）の光学系に関する。

【0002】〔従来の技術〕従来ミラータイプの等倍一括投影露光装置、レンズタイプのステツバがある。

【0003】〔発明が解決しようとする課題〕従来のミラータイプの等倍一括投影露光装置の光学系では、等倍率の線状の像しか得られていないので、マスク像の精密位置合わせが難しく、塵埃による影響が大きく、全欠陥を修正することが困難である等の問題があった。

【0004】従来のレンズタイプのステツバでは、短波長紫外線でレンズに使用可能な透明物質の少なさ、透明度の低さ、又レンズの耐久性の問題があった。

【0005】本発明は、短波長紫外線を使用することのできるミラータイプの光学系を有し高解像度、広い露光面積で深い焦点深度を有するステツバを提供することを目的としている。

【0006】〔課題を解決するための手段〕上記目的を達成するために、本発明ステツバの光学系においては、比較的広い波長域の高コヒーレント光を光源とし、集光凹面鏡にてレチクルの前方の一点に集中さし

【0007】その光の集中する一点に平面鏡の有する小孔を一致して平面鏡を設置し、

【0008】その平面鏡の鏡面の対面に凹面鏡を設置し、その凹面鏡の焦点と平面鏡の小孔とが一致する様に

【0009】光源からの光がレチクルを照射し、平面鏡の小孔を通過し凹面鏡でほぼ平行光線となり、同じ平面鏡で反射して進行する平行光線に垂直な極めて薄い透明窓板を設置し、

【0010】その透明窓板に極めて近接して、ウエハを設置しそのウエハ上にレチクル像を縮小結像する。

【0011】そしてレチクルは、像面彎曲を補正する曲面に作製している。

【0012】光学系の間の空間を透明な液体で満たし、その透明な液体を循環させることが後記する理由により効果的である。

【0013】〔作用〕レチクルを透過した光も高コヒーレントであり、波長 λ 、集光凹面鏡の口径D、焦点距離をfとすると、 $r=1.22\lambda f/D$ の半径内に全光量

2

の84.6%がレチクルの前方にある平面鏡の小孔に集中する。その周囲はレチクルの回折像を呈する。

【0014】本発明ではレチクル、透明窓板は合成石英で出来ているので、表面を滑らかに研磨でき、高コヒーレント光使用による表面の影響が小さい。

【0015】本発明では、透明窓でもって外界と隔絶されているので、空気の対流が少なく又塵埃の侵入を防いでいる。本発明全体を真空中に近づけると、空気の対流や塵埃の影響が小さくなる。

10 【0016】反対にミラー光学系の間の空間を透明な液体で満たし、その透明な液体を循環させることにより、レチクル、透明窓板の表面の影響は小さくなり、又塵埃の影響が小さくなる。そして透明な液体に光が吸収されるための温度上昇による光の屈折率を変化を防いでいる。

【0017】透明窓は極めて薄く、凹面鏡と平面鏡とで反射された光と垂直に設置されているので、色収差は生じない。

20 【0018】本発明では、平板鏡とレチクルとの間に平板鏡の小孔の周囲に電気集塵装置を設置しているので、ステツバ内の塵埃を取り除き、平板鏡の小孔を通じてのミラー光学系への塵埃の侵入を防いでいる。

【0019】本発明では、レチクル上の像パターンは透明な部分が多い程良いので、像形成にあたって考慮する必要がある。像パターンによっては、ホトレジストの像の反転を施行した方が良い場合もありうる。

30 【0020】本発明ステツバで製造したLSIは、中心部に平板鏡の小孔に対応する欠損部が存在するが、小孔は直径1mm程度であるので、LSI集積度に対する影響はない。もちろん光源の光量を大きく出来れば、小孔の直径はもっと小さく設定できる。

40 【0021】〔実施例〕実施例について図面を参照して説明すると、図1においてキセノン灯1、フィルタ2、スリット3、回転楕円凹面鏡4、レチクル5、平面鏡7の小孔8、放物面鏡10、平面鏡7、透明窓板11、ウエハ12、とこの順序でキセノン灯1からの光の光学的通路に設置し、回転楕円凹面鏡の一方の焦点にスリット3、もう一方の焦点に平面鏡7の小孔8を設置する。又小孔8は同時に放物面鏡10の焦点ともなっている。この時平面鏡7の鏡面9は放物面鏡10と向かいあって設置され、小孔8の周囲には電気集塵装置6が取り付けられている。

【0022】キセノン灯1の代りにArF、KrF等の数種類のガスを混合し、発振波長を動揺さすエキシマレーザーを光源とした実施例がある。

【0023】透明窓板11の代りに収差補正用レンズを使用した実施例がある。

【0024】放物面鏡10の代りに球面鏡、双曲面鏡等他の凹面鏡を使用した実施例がある。

50 【0025】図2に示される実施例では、光学系の間の空間を透明な液体で満たし、その透明な液体を循環さし

ている。レチクル5は透明な液体を満たす槽13に浸されている。

〔0026〕〔考案の効果〕本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。

〔0027〕レチクル照射光源は、高コヒーレント光を使用し、回転楕円凹面鏡にてレチクルの前方の一点に集中させているので、波長 λ 、回転楕円凹面鏡の口径D、焦点距離をfとすると、 $\gamma = 1.22 f / D$ の半径内に全光量の84.6%がレチクルの前方にある平面鏡の小孔に集中する。小孔の周囲はレチクルの回折像となるが、小孔の中心部は小孔の光の波長の幅の周辺リング状のフチ部と比較して極めて高い光量となるので、小孔のフチ部を光が通過して回折が生じるその割合は極めて小さくなっている。従って光が小孔を通過することによる解像力の低下は極めて小さい。この効果は小孔が $\gamma = 1.22 \lambda f / D$ の半径に近づくにつれて大きくなる。

〔0028〕ウエハの表面上の像の各点に到達する光の大部分は、放物面鏡の対応する極めて小さい範囲で反射されたものであるので、焦点深度も深く像面彎曲や像面歪曲以外の収差は極めて小さくなっている。

〔0029〕又ウエハの表面上の像の各点に到達する光の大部分は、放物面鏡の対応する極めて小さい範囲で反射されたものであるので、放物面鏡の計算上な開口数より実効開口数は大きくなる。

〔0030〕照射光源に高コヒーレント光を使用すると、レチクル像の回折現象でスベツクル雑音等が出現するが、レチクル像の10分の1程度に縮小するタイプであるため、レチクル像パターンを大きくとる事ができると、色収差がないので波長域幅を広くとることにより、高コヒーレント光を光源に使用しても像の劣化はな

い。

〔0031〕本発明ステツパで、露光面積 $\phi 30\text{mm}$ 程度、計算上の開口数0.35程度、(実効開口数はもっと大)が得られる。

〔0032〕本発明は、ミラータイプの光学系を使用しているので、レンズタイプの光学系使用ステツパより短波長紫外線を使用できる。

〔0033〕光学系の間の空間を透明な液体で満たすことにより、光の波長を λ 、透明な液体の屈折率を η とすると、 λ / η の光を使用したと同じ効果がある。

〔図面の簡単な説明〕

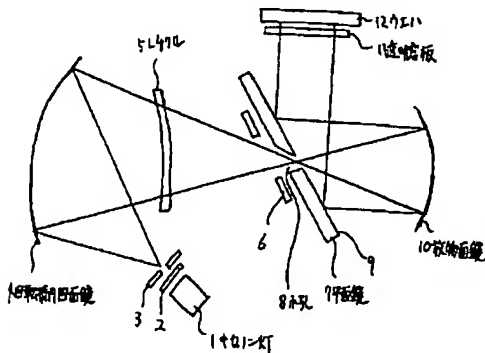
〔図1〕本発明ステツパの1実施例の構成ブロック図である。

〔図2〕本発明ステツパの光学系間を透明な液体で満たした実施例のレチクル周辺部の構成図である。

〔符号の説明〕

- 1 キセノン灯
- 2 フィルタ
- 3 スリット
- 4 回転楕円凹面鏡
- 5 レチクル
- 6 電気集塵装置
- 7 平面鏡
- 8 小孔
- 9 平面鏡の鏡面
- 10 放物面鏡
- 11 透明窓板
- 12 ウエハ
- 13 透明な液体を満たす槽
- 14 光学系を満たす透明な液体の流れ

【図1】



【図2】

